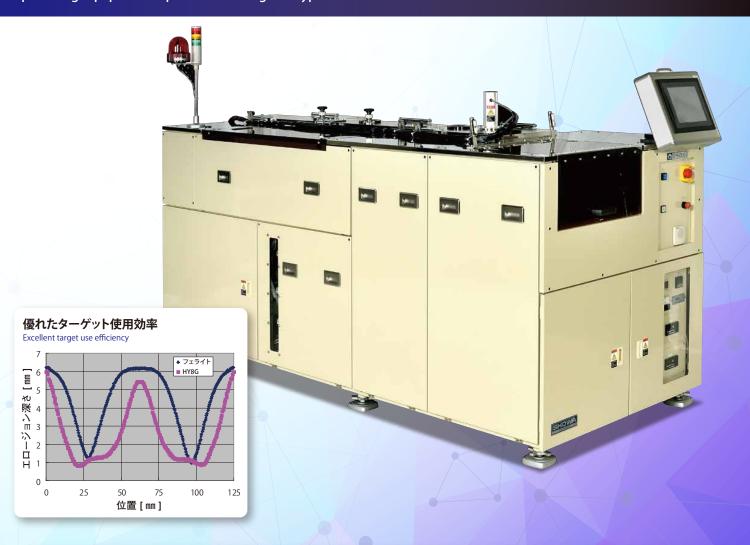
二種類の膜を両面に成膜可能なスパッタ装置

Sputtering equipment capable of forming two types of films on both sides



【概

本装置は水晶振動子のベース電極成膜を目的として開発したロードロック 式スパッタ装置です。仕込室、成膜室の2室からなり、加熱から成膜、取出ま でを全自動で連動して行うことにより、「ベース電極成膜工程」のライン化が 可能となり生産性の向上と省力化に貢献します。両面同時成膜によりハイタ クトで稼働できます。

[General Outline]

This equipment is a load lock type sputter equipment developed for the purpose of film formation of base electrode of quartz crystal. Consists of two chambers (a loading chamber and a film forming chamber), and by performing fully automatic interlocking from heating to film forming and taking out, it becomes possible to make the line of "base electrode film forming process" and improve productivity and save labor. High tact operation is possible due to simultaneous film formation on both sides.

【オプション】

DCボンバード機構(表面改質用)

[Options]

DC bombard mechanism (for surface modification)

【特 長】

- 1. 外形:W1,100mm×D2,500mm×H1,205mm 低背化を実現しています。
- 2. ターゲット使用効率約40%。
- 3. ラック&ピニオン方式を採用し安定した搬送を 実現しました。

- 1. Outer dimensions: W1,100mm \times D 2,500mm \times H 1,205mm, Lower height
- 2. Use target efficiency: about 40%.
- 3. Adopted a rack and pinion system to achieve stable conveyance.

【用途•応用例】

各種電子部品への電極用金属膜の形成

[Applications]

Formation of metal films for electrodes on various electronic components

SPH-2500T-II

ロードロック式 スパッタ装置

Load lock type sputtering equipment

二種類の膜を両面に成膜可能なスパッタ装置

Sputtering equipment capable of forming two types of films on both sides

装置構成 Outline	
処理方式	ロードロック式、通過型
Processing Method	Load lock type, Passing type
排気ポンプ	油回転ポンプ+ターボ分子ポンプ ※オプション:クライオポンプ対応可
Exhaust Pump	Rotary Pump + Turbo Molecular Pump *Option: Cryo pump compatible
設置寸法	W1,100mm×D3,640mm×H1,680mm
Installation dimensions	W1,100mm×D3,640mm×H1,680mm
装置重量	1,900kg
Equipment Weight	1,900kg
電源容量	AC200V \sim 220V (3 φ) / 27kVA (78A)
Power Supply capacity	AC200V \sim 220V(3 φ) / 27kVA(78A)
カソード	5インチ×7インチ 2対(うち1対が高使用効率カソード)
Cathode	5Inch×7inch 2sets(one of 2sets is high efficiency cathode)
トレイサイズ	L350mm×H139mm
Tray Size	L350mm×H139mm
基板搬送方式	ラック&ピニオン搬送
Tray Conveyance	Rack&Pinion
ストッカー	10トレイ収納
Stocker	Stores 10 trays

能 Performance トレイ内 ±1.2%/トレイ間 ±1.5% 膜厚分布 Uniformity ※成膜有効範囲±50mm Inside trays $\pm 1.2\%$ / Between trays $\pm 1.5\%$ * Effective range of film formation \pm 50mm ターゲット使用効率 40% About 40% Target Use Efficiency サイクルタイム 3min/トレイ ※Cr:8nm、Ag:45nm成膜時 1トレイ目除く Cycle Time 3 min / tray * when forming films by Cr: 8nm, Ag: 45nm. First tray is excluded. 到達圧力 仕込/取出室 1.0×10-3Pa以下 Ultimate Pressure SP室 1.0×10-3Pa以下 LD / ULD chamber 10-3Pa or less SP chamber 10⁻³Pa or less 排気時間 仕込/取出室 2.0×10-2Pa迄 3分以内 **Pumping Time** SP室 1.2×10-2Pa迄 10分以内 LD / ULD chamber within 3min until 2.0×10⁻²Pa SP chamber within 10min until 1.2×10-2Pa 150℃以上を確認 基板加熱温度 Substrate Heating Temperature 150℃ or higher

ラック&ピニオン方式採用

Rack and pinion system adopted

※本仕様・外観については、改良のため予告なく変更になることがあります。あらかじめご了承下さい。

カソードの改良により ターゲット使用効率が約40%になりました。

Target use efficiency has been increased to about 40% by improving the cathode.

操作性の向上

Improvement of the operability





警報発生時のトラブルシューティングを画面上に表示しま す。各トレイにレシピ設定が可能で10レイヤー/トレイまで 成膜が可能です。

Displays troubleshooting on the screen when an alarm occurs. Recipe can be set for each tray, and up to 10 layers / trays can be deposited.



株式会社昭和真空 SHOWA SHINKU CO., LTD.

ご質問・詳細につきましては、 営業部までお気軽にお問合せください。

お問合せ先【営業部】

本社•相模原工場

〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名3062-10

TEL. 042-764-0370

FAX. 042-764-0377

E-mail. sales-pamphlet@showashinku.co.jp

https://www.showashinku.co.jp/

昭和真空

検索

Inquiry [Sales Dept.]

HQ and Sagamihara Plant

3062-10 Tana, Chuo-ku, Sagamihara-city, Kanagawa 252-0244 Japan TEL:+81-42-764-0370 FAX:+81-42-764-0377

本製品は、外国為替並びに外国貿易管理法の規定により、戦略 物資等輸出規制品に該当する場合があります。従って、日本国 外に該当品を持ち出す際は、日本国政府への輸出許可申請等、 必要な手続きをお取りください。

This product may be applicable to export control products such as strategic raw materials which are regulated by the Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law. Accordingly when you bring out the applicable products outside Japan, you should take a necessary action such as application of an export permit to the Government of Japan

Web site 製品情報ページ

真空中で特定の基板に薄膜を形成させ る装置を主とした、真空蒸着装置やス パッタリング装置等の真空技術応用装 置(真空装置)を製造販売しております。



https://www.showashinku.co.jp/product/

^{*} For the improvement of the product, please understand in advance that the specifications and external views are subject to change without prior notice